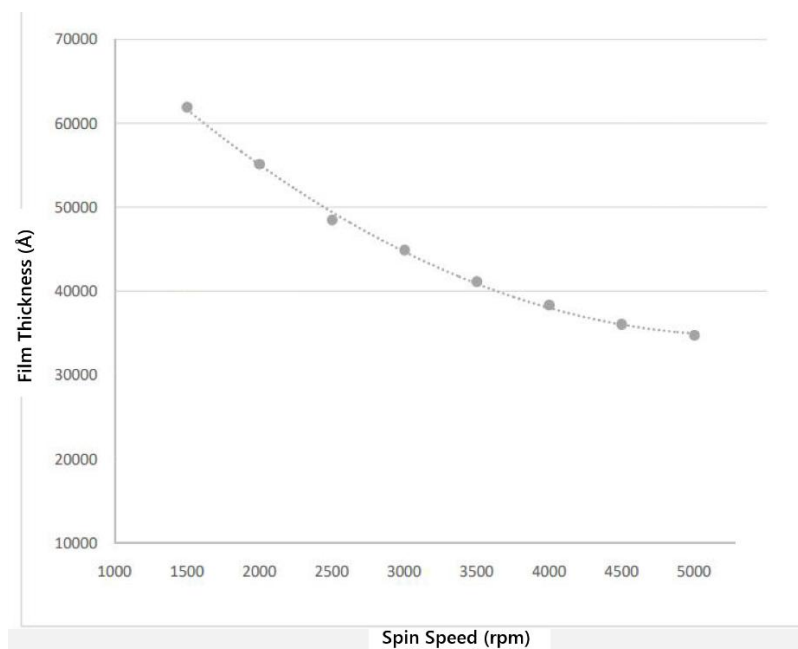


НЕГАТИВНЫЙ ФОТОРЕЗИСТ AR-311NL

AR-311NL представляет собой негативный фоторезист из диазидоциклизованного каучука, хорошо подходящий для производства полупроводниковых дискретных устройств и интегральных схем.

Фоторезист обладает:

- высоким термическим сопротивлением
- высокой химической стабильностью и очень хорошей адгезией
- высоким разрешением до 2 мкм.
- диапазон толщины плёнки от 3,5 до 6,2 мкм



Кинематическая вязкость при температуре 25°C - 300 ± 10 сСт

Мягкая сушка - 100°C, 30 мин (печь) и 90°C, 90 сек. (плита)

Жёсткая сушка - 140°C, 30 мин. (печь) и 150°C, 3 мин. (плита)

Экспонирование – 30 - 40 мДж/см ²
--

Условия хранения и применения:

Хранить в закрытом оригинальном контейнере.

Защищайте от солнечного света.

Хранить в прохладном и сухом помещении.

Рекомендуется постоянная температура от 0 до 25 °C.

Применение при желтом освещении.

Срок годности при соблюдении условий хранения 12 месяцев от даты производства.